# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

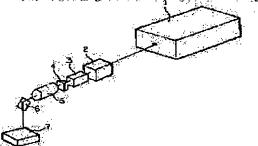
(11)Publication number : 08-197271 (43)Date of publication of application : 06.08.1996

(51)Int.Cl.		B23K 26/00 B23K 26/06		
(21)Application number : 07–011152		(71)Applicant : RICOH CO LTD		
(22)Date of filing :	27.01.1995	(72)Inventor : OGAKI TAKASHI TEZUKA SHINJI		

## (54) METHOD FOR CRACKING BRITTLE MATERIAL AND DEVICE FOR CRACKING BRITTLE MATERIAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve cracking accuracy and to improve a cracking speed by forming an energy beam to a beam aligned to a desired cracking line and irradiating a work with the beam, thereby cracking the work. CONSTITUTION: The energy beam is oscillated by a beam generator 1, such as laser, and after the oscillated energy beam is subjected to energy adjustment with an attenuator 2, the energy beam is made uniform by a beam homogeneizer 3. The beam made uniform by the beam homogeneizer 3 is passed through a mask 4 and the mask image is made into the linear beam aligned to the desired cracking line by a total reflection mirror 6 of an imaging lens system 5. The linear beam is imaged on the work 7. As a result, the exacter control of the beam by the cracking direction is made possible and the cracking of the work to a wire shape with high accuracy is made possible. The cracking accuracy is thus improved.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application] [Patent number] [Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection] [Date of extinction of right]

•·· • •• • • • • •

- ·

. ....

. . .

.....

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 7 頁)

会社リコー内 (72)発明者 手塚 伸治

会社リコー内 (74)代理人 弁理士 有我 軍一郎

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

. . . . .

## (19)日本国特許庁(JP) (12)公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

# 特開平8-197271

(43)公開日 平成8年(1996)8月6日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	<b>广内整理番号</b>	FI	技術表示箇所
B 2 3 K	26/00	320	E		
	26/06		С		
			E		

特願平7-11152	(71)出願人 000006747
	株式会社リコー
平成7年(1995)1月27日	東京都大田区中馬込1丁目3番6号
	(72) 発明者 大垣 傑

(54) 【発明の名称】 脆性材料の割断方法及び脆性材料の割断装置

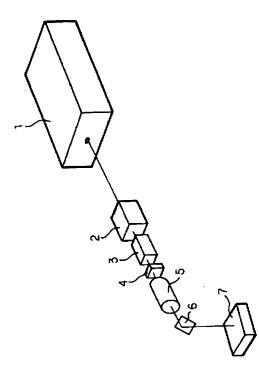
(57)【要約】

(21)出願番号

(22)出顧日

【目的】 割断精度を向上させることができるととも に、割断速度を向上させることができる。

【構成】 脆性材料からなる被加工物を割断する方法に おいて、エネルギービームをその割断予定線に合わせた ビームにして該被加工物に照射して該被加工物を割断す る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 脆性材料からなる被加工物を割断する方法 において、エネルギービームをその割断予定線に合わせ たビームにして該被加工物に照射して該被加工物を割断 することを特徴とする脆性材料の割断方法。

【請求項2】前記エネルギービームを前記割断予定線上 に複数本、同時に走査させることを特徴とする請求項1 記載の脆性材料の割断方法。

【請求項3】前記エネルギービームを同一ビームの分波 により形成することを特徴とする請求項2記載の脆性材 料の割断方法。

【請求項4】前記エネルギービームの2本のうち、一方 のエネルギービームを熱応力を付与するためのビームと し、他方のエネルギービームを亀裂を発生させるための ビームとすることを特徴とする請求項2記載の脆性材料 の割断方法。

【請求項5】熱応力を付与するための前記エネルギービ ームをYAGレーザとし、亀裂を発生させるための前記 エネルギービームを該YAGレーザの高調波とすること を特徴とする請求項4記載の脆性材料の割断方法。2022

【請求項6】 亀裂を発生させるための前記エネルギービ ームを、エキシマレーザを走査することによりポイント 状に与えることを特徴とする請求項4記載の脆性材料の 割断方法。

【請求項7】 亀裂を発生させるための応力源をダイヤモンド針の走査による物理的方法により形成することを特徴とする請求項4乃至6記載の脆性材料の割断方法。

【請求項8】脆性材料からなる被加工物を割断する装置 において、エネルギービームを出射するビーム発生手段 と、出射したエネルギービームをその割断予定線に合わ 30 せたビームに調整するビーム調整手段と、調整したビー ムを該被加工物上に結像する結像手段とを有することを 特徴とする脆性材料の割断装置。

【請求項9】前記エネルギービームを前記割断予定線上 に複数本、同時に走査させる走査手段を設けることを特 徴とする請求項8記載の脆性材料の割断装置。

【請求項10】前記エネルギービームを同一ビームの分 波により形成する形成手段を設けることを特徴とする請 求項9記載の脆性材料の割断装置。

【請求項11】前記エネルギービームの2本のうち、ー 40 方のエネルギービームを熱応力を付与するためのビーム を生成する第1のビーム生成手段と、他方のエネルギー ビームを亀裂を発生させるためのビームを生成する第2 のビーム生成手段とを設けることを特徴とする請求項9 記載の脆性材料の割断装置。

【請求項12】熱応力を付与するためのエネルギービー ムをYAGレーザで出射する出射手段と、亀裂を発生さ せるためのエネルギービームを該YAGレーザの高調波 に調整する調整手段とを設けることを特徴とする請求項 9記載の脆性材料の割断装置。 2

【請求項13】前記第2のビーム生成手段は、エキシマ レーザからなることを特徴とする請求項11,12記載 の脆性材料の割断装置。

【請求項14】 亀裂を発生させるダイヤモンド針を有す る応力手段を設けることを特徴とする請求項11乃至1 3記載の脆性材料の割断装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、脆性材料の割断方法及 び脆性材料の割断装置に係り、詳しくは、LCD用ガラ ス基板、アルミナセラミックス等の切断、Siデバイ ス、化合物半導体等のダイシングに適用することができ る他、基板、レンズ等のバルク材料からの切り出しに応 用することができ、特に、割断精度を向上させることが できるとともに、割断速度を向上させることができる脆 性材料の割断方法及び脆性材料の割断装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、被加工材料に発生する集中熱応力 を用いたレーザを熱源とする脆性材料の割断加工方法及

び割断加工装置については、特開平3-489号公報で 報告されたものがある。この従来の脆性材料の割断加工 方法及び割断加工装置では、脆性材料よりなる被加工材 料にレーザビームを高エネルギー密度に集束させて瞬時 に穴を空け、その穴の周りに亀裂を発生させて、これを 加工開始点とし、レーザビームを熱源として加工線近傍 を加熱することで発生する熱応力により、で亀裂を加工 線に沿って進展させるように構成している。

【0003】このため、被加工材料全体を冷却して亀裂 の進展速度を向上させることができるので、加工テーブ ル上で脆性材料の割断加工の全ての工程を実施すること ができ、複雑な形状の割断を行うことができるという利 点を有する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し た従来の脆性材料の割断加工方法では、加工開始点とな るポイントが同一ビームによる溶融加工により形成され ており、その亀裂の伝播方向はビームによって与えられ たブロードな熱応力分布に従っているため、伝播位置精 度を正確に規定することが難しく、割断精度が低下する という問題があった。

【0005】また、単一ビームにより亀裂の伝播を順送 りしているため、その割断速度をある程度以上上げるこ とができないという問題があった。そこで、本発明は、 割断精度を向上させることができるとともに、割断速度 を向上させることができる脆性材料の割断方法及び脆性 材料の割断装置を提供することを目的としている。 【0006】

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、 脆性材料からなる被加工物を割断する方法において、エ ネルギービームをその割断予定線に合わせたビームにし

て該被加工物に照射して該被加工物を割断することを特 徴とするものである。請求項2記載の発明は、上記請求 項1記載の発明において、前記エネルギービームを前記 割断予定線上に複数本、同時に走査させることを特徴と するものである。

【0007】請求項3記載の発明は、上記請求項2記載 の発明において、前記エネルギービームを同一ビームの 分波により形成することを特徴とするものである。請求 項4記載の発明は、上記請求項2記載の発明において、 前記エネルギービームの2本のうち、一方のエネルギー ビームを熱応力を付与するためのビームとし、他方のエ ネルギービームを亀裂を発生させるためのビームとする ことを特徴とするものである。

【0008】請求項5記載の発明は、上記請求項4記載 の発明において、熱応力を付与するための前記エネルギ ービームをYAGレーザとし、亀裂を発生させるための 前記エネルギービームを該YAGレーザの高調波とする ことを特徴とするものである。請求項6記載の発明は、 上記請求項4記載の発明において、亀裂を発生させるた めの前記エネルギービームを、エキジマレーザを走査す 20 ることによりポイント状に与えることを特徴とするもの である。

【0009】請求項7記載の発明は、上記請求項4乃至 6記載の発明において、亀裂を発生させるための応力源 をダイヤモンド針の走査による物理的方法により形成す ることを特徴とするものである。請求項8記載の発明 は、脆性材料からなる被加工物を割断する装置におい て、エネルギービームを出射するビーム発生手段と、出 射したエネルギービームをその割断予定線に合わせたビ ームに調整するビーム調整手段と、調整したビームを該 被加工物上に結像する結像手段とを有することを特徴と するものである。

【0010】請求項9記載の発明は、上記請求項8記載 の発明において、前記エネルギービームを前記割断予定 線上に複数本、同時に走査させる走査手段を設けること を特徴とするものである。請求項10記載の発明は、上 記請求項9記載の発明において、前記エネルギービーム を同一ビームの分波により形成する形成手段を設けるこ とを特徴とするものである。

【0011】請求項11記載の発明は、上記請求項9記 載の発明において、前記エネルギービームの2本のう ち、一方のエネルギービームを熱応力を付与するための ビームを生成する第1のビーム生成手段と、他方のエネ ルギービームを亀裂を発生させるためのビームを生成す る第2のビーム生成手段とを設けることを特徴とするも

【0012】請求項12記載の発明は、上記請求項9記 載の発明において、熱応力を付与するためのエネルギー ビームをYAGレーザで出射する出射手段と、亀裂を発 生させるためのエネルギービームを該YAGレーザの高 50

のである。

調波に調整する調整手段とを設けることを特徴とするも のである。請求項13記載の発明は、上記請求項11, 12記載の発明において、前記第2のビーム生成手段 は、エキシマレーザからなることを特徴とするものであ る。

【0013】請求項14記載の発明は、上記請求項11 乃至13記載の発明において、亀裂を発生させるダイヤ モンド針を有する応力手段を設けることを特徴とするも のである。

### 10 [0014]

【作用】請求項1記載の発明では、エネルギービームを その割断予定線に合わせたビームにして被加工物に照射 して被加工物を割断するように構成する。このため、エ ネルギービームを割断予定線に沿ってアライメントする ことができるので、割断方向をより正確に制御すること ができる。従って、割断の方向性を向上させることがで きるため、割断精度を向上させることができる。

【0015】請求項2記載の発明では、エネルギービー ムを割断予定線上に複数本、同時に走査させるように構 成する。このため、エネルギービームを割断予定線上に 複数本同時に走査することができるので、亀裂伝播方向 を規制して割断精度を向上させることができると同時

に、割断速度を飛躍的に向上させることができる。 【0016】請求項3記載の発明では、エネルギービー ムを同一ビームの分波により形成するように構成する。 このため、複数のエネルギービームを同一ビーム源より 分割して取り出して割断予定線上にビームを照射するこ とができるので、ビーム発振装置や電源を余分に増設し ないで済ませることができ、装置の縮小化及び低コスト 化を図ることができる。

【0017】請求項4記載の発明では、エネルギービー ムの2本のうち、一方のエネルギービームを熱応力を付 与するためのビームとし、他方のエネルギービームを亀 裂を発生させるためのビームとするように構成する。こ のため、熱応力を付与するエネルギービームと亀裂を発 生させるエネルギービームとを各々別個に形成すること ができるので、熱応力と亀裂を同時に与えることがで き、割断位置(亀裂発生位置)をより正確に、かつ確実 に規定することができる。

【0018】請求項5記載の発明では、熱応力を付与す るためのエネルギービームをYAGレーザとし、亀裂を 発生させるためのエネルギービームをYAGレーザの高 調液とするように構成する。このため、同一のエネルギ ービーム源をYAGとその高調液に分解することによ り、割断予定線上にビームを照射することができるの で、熱応力と亀裂を同時に効率良く与えることができ る。しかも、発振器や電源を余分に設置しないで済ませ ることができるため、装置の縮小化及び低コスト化を図 ることができる。

【0019】請求項6記載の発明では、亀裂を発生させ

るためのエネルギービームを、エキシマレーザを走査す ることによりポイント状に与えるように構成する。この ため、エキシマレーザによってミシン目状に亀裂発生位 置を与えることができるので、精密な割断を行うことが できる。従って、より高精度な位置決めを行うことがで きるため、より高精度な割断精度を期待することができ る。

【0020】請求項7記載の発明では、亀裂を発生させ るための応力源をダイヤモンド針の走査による物理的方 法により形成するように構成する。このため、亀裂を発 10 生させる応力源をダイヤモンド針等の機械的方法によっ て与えて亀裂を発生させることができるので、装置の縮 小化及び低コスト化を図ることができる。

【0021】請求項8記載の発明では、エネルギービー ムをビーム発生手段により出射し、出射したエネルギー ビームをビーム調整手段によりその割断予定線に合わせ たビームに調整し、調整したビームを結像手段により被 加工物に結像するように構成する。このため、エネルギ ービームを割断予定線に沿ってアライメントすることが できるので、割断方向をより正確に制御することができ 20<sup>-</sup> る。従って、割断の方向性を向上させることができるた め、割断精度を向上させることができる。

【0022】請求項9記載の発明では、エネルギービー ムを走査手段により割断予定線上に複数本、同時に走査 させるように構成する。このため、エネルギービームを 割断予定線上に複数本同時に走査することができるの で、亀裂伝播方向を規制して割断精度を向上させること ができると同時に、割断速度を飛躍的に向上させること ができる。

【0023】請求項10記載の発明では、エネルギービ ームを形成手段により同一ビームの分波により形成する ように構成する。このため、複数のエネルギービームを 同一ビーム源より分割して取り出して割断予定線上にビ ームを照射することができるので、ビーム発振装置や電 源を余分に増設しないで済ませることができ、装置の縮 小化及び低コスト化を図ることができる。

【0024】請求項11記載の発明では、エネルギービ ームの2本のうち、一方のエネルギービームを第1のビ ーム生成手段により熱応力を付与するためのビームに生 成し、他方のエネルギービームを第2のビーム生成手段 40 により亀裂を発生させるためのビームに生成するように 構成する。このため、熱応力を付与するエネルギービー ムと亀裂を発生させるエネルギービームとを各々別個に 形成することができるので、熱応力と亀裂を同時に与え ることができ、割断位置(亀裂発生位置)をより正確 に、かつ確実に規定することができる。

【0025】請求項12記載の発明では、熱応力を付与 するためのエネルギービームを出射手段によりYAGレ ーザで出射し、亀裂を発生させるためのエネルギービー ムを調整手段によりYAGレーザの高調波に調整するよ 50

うに構成する。このため、同一のエネルギービーム源を YAGとその高調波に分解することにより、割断予定線 上にビームを照射することができるので、熱応力と亀裂 を同時に効率良く与えることができる。しかも、発振器 や電源を余分に設置しないで済ませることができるた め、装置の縮小化及び低コスト化を図ることができる。 【0026】請求項13記載の発明では、亀裂を発生さ せるためのエネルギービームを、エキシマレーザからな るように構成する。このため、エキシマレーザによって ミシン目状に亀裂発生位置を与えることができるので、 精密な割断を行うことができる。従って、より髙精度な 位置決めを行うことができるため、より高精度な割断精 度を期待することができる。 【0027】請求項14記載の発明では、ダイヤモンド 針を有する応力手段により亀裂を発生させるように構成 する。このため、亀裂を発生させる応力源をダイヤモン ド針等の機械的方法によって与えて亀裂を発生させるこ とができるので、装置の縮小化及び低コスト化を図るこ とができる。

【0028】 【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して説明 する。

(実施例1)図1は本発明に係る実施例1の脆性材料の 割断装置及び割断方法を示す図である。

【0029】本実施例では、まず、レーザ等のビーム発 生装置1によりエネルギービームを発振し、発振したエ ネルギービームをアッテネータ2でエネルギー調整した 後、ビームホモジェナイザ3にて均一化する。そして、 ビームホモジェナイザ3で均一化したビームをマスク4

に通し、そのマスクイメージを結像レンズ系5と全反射 ミラー6でワーク7上に結像させる。

【0030】この時、マスクイメージは、図2に示す如 く、割断予定線に合致した線状Aにしてワーク7面上に 結像させる。このように、本実施例(請求項1,8)で は、ビーム発生装置1によりエネルギービームを出射 し、出射したエネルギービームを、アッテネータ2でエ ネルギー調整し、ビームホモジェナイザ3で均一化した 後、マスク4に通し、このマスクイメージを、結像レン ズ系5及び全反射ミラー6により割断予定線に合致した 線状ビームにしてワーク7に結像させるように構成して いる。

【0031】このため、エネルギービームを線状ビーム にして割断予定線に沿ってアライメントすることができ るので、割断方向をより正確に制御することができる。 従って、割断の方向性を向上させることができる。ま た、熱応力の発生位置を線状にすることができるため、 線状に割断する時、高精度で線状に割断することがで き、割断精度を向上させることができる。

【0032】なお、上記実施例1では、マスクイメージ を、割断予定線にアライメントし易く、直線上に割断す

30

50

る時に好適な線状Aにしてワーク7面上に結像させる場 合を説明したが、本発明はこれのみに限定されるもので はなく、図2に示す如く、例えば割断予定線にアライメ ントし易い楔形状Bにしてワーク7面上に結像させるよ うに構成してもよい。また、例えば簡便に元ビームにシ リンドリカルレンズをかませることによって、割断予定 線に合致した円形状Cのビーム形状をD部の如く、割断 方向に引き延ばすように構成してもよく、この場合、楕 円形状に割断したい時に有効である。

7

(実施例2)次に、図3は本発明に係る実施例2の脆性 材料の割断方法を示す図である。図示例は、図1,20 脆性材料の割断方法に適用させることができる。

【0033】本実施例(請求項2,9)では、エネルギ ービームを走査手段により割断予定線上に3本、同時に 走査させて照射するように構成する。このため、エネル ギービームを割断予定線上に3本同時に走査して照射す ることができるので、割断予定線上に単数のエネルギー ビームを照射する場合よりも、更に亀裂伝播方向を規制 して割断精度を向上させることができると同時に、割断 速度を飛躍的に向上させることができる。

(実施例3)次に、図4は本発明に係る実施例3の脆性 材料の割断装置及び割断方法を示す図である。図示例 は、図2の割断方法に適用することができる。

【0034】本実施例では、レーザ発振器10から発振 されたレーザ光をハーフミラー11,12及び全反射ミ ラー13によって3本に分波し、各々のビームを割断予 定線上に投影させる。この時のビームの走査は、ワーク 7を走査させて構成してもよいし、各々ガルバノミラー 等によって走査させるように構成してもよい。本実施例

(請求項3,10)では、ビーム発生装置1から発振し たレーザ光をハーフミラー11,12及び全反射ミラー 13によって3本に分波し、各々分波したビームを割断 予定線上に投影させるように構成している。

【0035】このため、3本のビームを同一ビーム源の ビーム発生装置1よりハーフミラー11,12及び全反 射ミラー13によって分割して取り出し割断予定線上に 各々ビームを照射することができるので、ビーム発振装 置や電源を余分に増設しないで済ませることができ、装 置の縮小化及び低コスト化を図ることができる。

(実施例4)次に、図5は本発明に係る実施例4の脆性 40 材料の割断装置及び割断方法を示す図である。図示例 は、図3の割断方法に適用することができる。

【0036】本実施例(請求項4,11)では、レーザ 発振器20から発振したレーザ光を熱応力を発生させる ためのビームとして全反射ミラー22で反射して割断予 定線上に投影するとともに、レーザ発振器20に後続の レーザ発振器21から発振したレーザ光を微小な亀裂を 発生させるためのビームとして全反射ミラー23で反射 して割断予定線上に投影し、その割断位置を規定するよ うに構成する。 【0037】このため、熱応力を付与するエネルギービ ームと亀裂を発生させるエネルギービームとを各々別個 に形成することができるので、熱応力と亀裂を同時に与 えることができ、割断位置(亀裂発生位置)をより正確 に、かつ確実に規定することができる。

(実施例5)次に、図6は本発明に係る実施例5の脆性 材料の割断装置及び割断方法を示す図である。図示例 は、図3の割断方法に適用することができる。

【0038】本実施例では、レーザ発振器31から発振 した熱応力を付与するためのレーザ光をYAGレーザと し、ハーフミラー32により一部ワーク7上に照射した 後、FHG、SHG結晶33を通して波長を短波長化

(高調波)して全反射ミラー34で折り返し、結像レン ズ系35を通して所望の亀裂発生位置に照射する。この ように、本実施例(請求項5,12)では、レーザ発振 器31から出射する熱応力を付与するためのエネルギー ビームをYAGレーザとして、ハーフミラー32により 一部ワーク7上に照射し、亀裂を発生させるためのエネ ルギービームを結晶33に通してYAGレーザの高調波

20 にして、全反射ミラー34と結像レンズ系35により所 望の亀裂発生位置に照射するように構成している。 【0039】このため、同一のエネルギービーム源をY AGとその高調波に分解することにより、割断予定線上 にビームを照射することができるので、熱応力と亀裂を 同時に効率良く与えることができる。しかも、発振器や 電源を余分に設置しないで済ませることができるため、 装置の縮小化及び低コスト化を図ることができる。な お、上記実施例5では、亀裂を発生させるためのビーム にYAGレーザの高調波を用いて行う場合を説明した

が、本発明はこれのみに限定されるものではなく、本発 明(請求項6,13)においては、亀裂を発生させるた めのエネルギービームを、走査手段によりエキシマレー ザを走査することによりポイント状に与えるように構成 してもよい。

【0040】この場合、エキシマレーザによってミシン 目状に亀裂発生位置を与えることができるので、YAG レーザの高調波を用いる場合よりも、精密な割断を行う ことができる。従って、より高精度な位置決めを行うこ とができるため、より高精度な割断精度を期待すること ができる。

(実施例6)次に、図7は本発明に係る実施例6の脆性 材料の割断装置及び割断方法を示す図である。図示例 は、図5,6の割断方法に適用することができる。 【0041】本実施例(請求項7,14)では、レーザ 発振器41により出射する熱応力を発生させるためのレ ーザ光を全反射ミラー42で反射して熱応力集中位置に 照射するとともに、機械的応力を発生させ亀裂を与える ためのダイヤモンド針43を熱応力集中位置に重ね合わ せて割断を行うように構成する。このため、亀裂を発生 させる応力源をダイヤモンド針等の機械的方法によって

9

与えて亀裂を発生させることができるので、装置の縮小 化及び低コスト化を図ることができる。

[0042]

【発明の効果】本発明によれば、割断精度を向上させる ことができるとともに、割断速度を向上させることがで きるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る実施例1の脆性材料の割断装置及び割断方法を示す図である。

【図2】結像ビーム形状を示す図である。

【図3】本発明に係る実施例2の脆性材料の割断方法を 示す図である。

【図4】本発明に係る実施例3の脆性材料の割断装置及び割断方法を示す図である。

【図5】本発明に係る実施例4の脆性材料の割断装置及び割断方法を示す図である。

10

【図6】本発明に係る実施例5の脆性材料の割断装置及び割断方法を示す図である。

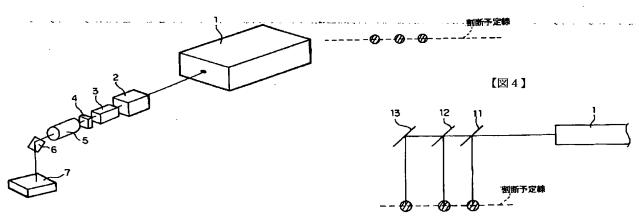
【図7】本発明に係る実施例6の脆性材料の割断装置及び割断方法を示す図である。

【符号の説明】

- 1 ビーム発生装置
- 2 アッテネータ
- 3 ビームホモジェナイザ
- 4 マスク
- 5,35 結像レンズ系 6,13,22,23,34,42 全
- 6,13,22,23,34,42 全反射ミラー 7 ワーク
- 10,20,21,31,41 レーザ発振器
- 11, 12, 32 ハーフミラー
- 33 結晶
- 43 ダイヤモンド針

【図3】



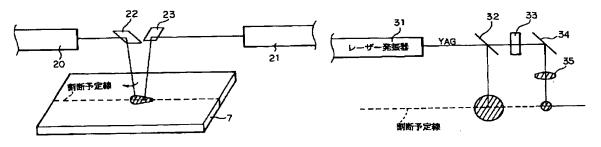






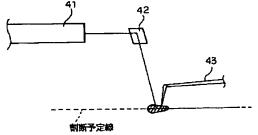


【図6】



۰.





...........

-, .

~

-----

. . . .